PASJ2023 TUP51

# コールドスプレーによる新しいニオブ超伝導空洞の製造方法の提案 A NOVEL MANUFACTURE OF NIOBIUM SRF CAVITIES BY COLD SPRAY

山中将<sup>#, A)</sup>, 嶋田慶太<sup>B)</sup> Masahi Yamanaka<sup>#, A)</sup>, Keita Shimada<sup>B)</sup> <sup>A)</sup> KEK <sup>B)</sup> Nihon University, College of Engineering

#### Abstract

Niobium coating technology has been developed for superconducting radiofrequency (SRF) cavities to reduce material costs. Cold spray (CS), a film formation method that feeds solid-state particles onto a target to form a thick film in a short time, is the focus of this study, with the aim of reducing the cost. To verify the feasibility of manufacturing an entire structure of SRF cavities using CS, an additive lathe method with CS was performed. Niobium particles were supplied through a CS gun manipulated by a robot arm to consistently orient the blast direction to the normal direction of an aluminum alloy sacrificial mandrel. Nb-made cavities were successfully fabricated by dissolving the mandrel in hydrochloric acid.

## 1. 緒言

超伝導加速空洞 (SRF 空洞) は粒子加速器の重要 な構成要素である。通常、SRF 空洞は純物質の中で 最大の超伝導転移温度 Tc(9.2 K)を有するニオブ (Nb) により製造される。Nb を上回る Tc を有する 化合物超伝導物質は存在するものの、高純度に安定 して製造できる点で Nb が現時点でも第一の材料で ある[1,2]。しかし、レアメタルとして扱われる Nb の材料費は巨大な加速器において問題となる。そこ で、コーティング技術による材料節減の研究が進め られている。1980 年、CERN にて銅空洞内への Nb のスパッタ成膜(以下、膜/基板物質の順でNb/Cuの ように膜と基板を表記する)が開発され、コーティ ング技術の研究が進められている。理論上、Nbの磁 場侵入深さ λ は 40 nm 程度と短いことから、超伝導 特性は表面近傍によって決定される[2]。一方、成膜 前の空洞表面の形状に倣って成膜されることから、 前加工で高レベルな鏡面加工が要求される[3]。また 実用上は成膜の不均一から追加工をしたいケースが あるものの、薄膜 Nb であると追加工が困難となる。 したがって、厚膜成膜技術は前加工面の精度を無視 して膜を形成し、後加工にて表面性状を整えること が可能となる点でメリットがある。

コールドスプレー(CS)は粉末材料を固相状態の まま高速で基材へ吹き付ける成膜技術であり、成膜 速度が高速であることが特長である。Kumarら[4]は Nb 粉末を用いた Cu 基板への CS を試みており、成 膜の達成と超伝導転移について報告している。一方、 CSにより Nb 製空洞形状をはじめとする形状創成に ついての報告はまだない。筆者らは空洞形状の創成 と超伝導特性の検証試験を行ったので報告する。

# 2. 実験

#### 2.1 コールドスプレー

本 実 験 で は Taniobis 社 製 の ニ オ ブ 粉 末 (Ampertec® TS niobium metal powder 10–30 µm)を 使用した。Figure 1 にその顕微写真を示す。また粉 末の化学組成を Table 1 にまとめる。CS はプラズマ 技研製装置(PCS-1000)を使用し、6 自由度ロボッ トアーム(Motoman MS80、安川電機)に把持した。 成膜条件を Table 2 にまとめる。実験は平板と空洞の



Figure 1: Laser microscopic photo of niobium powder observed with a confocal laser scanning microscope (VK-8510, Keyence, Japan).

<sup>#</sup> masashi.yamanaka@kek.jp

#### PASJ2023 TUP51

Table 1: Chemical Compositions of the Niobium Powder Measured by Manufacturer (unit: wt. ppm)

С	Н	N	0	Fe	Cr	Ni	Mn	Na	K	Mg	Ca	Si	Мо	Та	W
<10	<10	57	526	<2	<2	<2	<1	<1	<1	97	<3	<3	<4	73	<5

内部形状のマンドレル(ともにアルミニウム合金 (JIS A2024) 製)に対して Nb 粉を成膜した。マン ドレルの寸法は長さ90 mm、赤道部直径76 mm の 3.9 GHz空洞を模した形状である。ただし、CSの操作に より Al 基板は熱変形したため、基板のクランプ(鋳 鉄)に堆積した Nb 膜をアルミナ砥石により切断し て超伝導試験片を作成した。マンドレルは旋盤の主 軸に把持し、マンドレルに対して均一な膜が形成で きるよう回転させながら CS ガンを操作した(Fig. 2)。 成膜後、マンドレルは 35 wt% 塩酸に浸漬させるこ とにより除去した。

#### 2.2 超伝導試験

CSにより成膜した Nb 膜を 2 mm 厚に切り出した 試験片は硝酸・リン酸・フッ酸の混酸液にて化学研 磨 (CP)を施した。そのうちの一部を真空炉にて 3 h昇温、3 h 800 °C を保持、その後炉冷した。以下、 アニール前材、アニール後材と称する。それらア ニール前後材の Nb 試験片を真空低温チャンバ内で 伝導冷却にて 5 K 付近まで冷却し、冷凍機の電源を 切って昇温しながら四端子法にて電気抵抗を計測し て超伝導転移を確認した。

# 3. 実験結果

Figure 3 に CS によるマンドレルへの Nb 膜積層の 進展状況を示す。Figure 3(b)のように1回目のノズル スキャンでも Nb の積層が確認でき、Figure 3(c)のよ うに 320 s で厚膜形成が完了した。作製した試験片 をワイヤ放電加工にて対称に切断し、切断試験片と 塩酸によりマンドレルを除去した試験片を Figure 4 に示す。厚さ 2 mm 程度の厚膜の形成が確認できる。 塩酸でマンドレルを除去した試料は赤銅色に変色し ており、A2024 の成分による影響が考えられる。ま た Figure 4(b)、(c)のように Nb と Al の境界部であっ た箇所にて層間剥離がある。これは Nb-Al 境界での 密着性や塩酸により材料が除去されたことによる応 力開放が原因と考えられるが、いずれにしても SRF 空洞として使用するには機械研磨もしくは化学研磨 などの後工程を要することを示している。 Table 2: Conditions of Cold Spray for (a) Plate and (b) Mandrel

	(a)	(b)			
Working gas	Nitrogen				
Gas temperature	450 °C				
Gas pressure	3 MPa				
Nozzle traverse speed	20 mm/s	$\sim 20 \text{ mm/s}$			
Lathe rotation		250 min <sup>-1</sup>			
Standoff distance	20 mm	30 mm			
Number of repetitions	10	9			
Substrate material	A2024	A2024			



Figure 2: Schematic of the CS process for fabricating a cavity model: (a) additive lathe to form a thick film on the sacrificial Al alloy mandrel, (b) removing the mandrel to obtain the Nb alone cavity.

Figure 5 は CS により作製し CP 処理まで施した試 験片と、さらに真空アニール処理まで施した試験片 の温度・抵抗線図である。両試験片とも超伝導転移 した一方、アニール前材料はバルク Nb の  $T_c$ である 9.2 K 付近で超伝導転移したのに対して、アニール後 材では 8.8 K 程度から超伝導転移した。また、残留 抵抗比 (RRR) はアニール前材で  $10 \pm 0.01$ 、アニー ル後材で 7 ± 0.1 (±は標準偏差) であり、CS による Nb 膜の先行研究[4]の 3.42 やマグネトロンスパッタ [5]の 10–26、HiPIMS[6]の 4.36 と同等であった。

## 4. 結言

CSによりニオブ製構造体をアルミニウム合金のマンドレル上に製膜し、マンドレルを除去することにより CS による SRF 空洞形状を初めて達成した。



Figure 3: Progress of the CS additive lathe: (a) before CS, t = 0 s, (b) in the middle of the first pass t = 18 s, and (c) after CS, t = 320 s, where t is the elapsed time of the CS process.

RRR はこれまで報告されている成膜技術による値と 同等であった。今後は 1.3 GHz 空洞を製造し性能試 験を行う。

# 謝辞

本研究で使用したニオブ粉はタニオビスジャパン 株式会社より提供を受けた。またコールドスプレー による成膜実験は、プラズマ技研工業株式会社の オープンラボを使用して実施した。両社の協力に深 く感謝申し上げる。また KEK 共同開発研究、TIA か けはし事業、および KEK 加速器技術開発若手研究プ ログラムの助成を受けた。記して、謝意を表す。





Figure 4: Cross-section of the Nb/Al mandrel similar to 3.9 Hz SRF cavities; (a) as-CSed Nb/Al mandrel and Nb film alone dissolved by HCl solution, magnified pictures of (b) equator part, and (c) iris part.



Figure 5: Temperature–resistivity diagrams of as-received and annealed samples.

**PASJ2023 TUP51** 

# 参考文献

- [1] C. P. Poole *et al.*, "Introduction" in Handbook of Superconductivity, C P Poole, Ed. Academic Press, 1999, pp. 1–27.
- [2] A.-M. Valente-Feliciano, "Superconducting RF materials other than bulk niobium", Supercond. Sci. Technol., vol. 29, no. 11, 113002, 2016.
  - doi: 10.1088/0953-2048/29/11/113002
- [3] S. Calatroni, "20 Years of experience with the Nb/Cu technology for superconducting cavities and perspectives for future developments", Physica C, vol. 441 pp. 95–101, 2006. doi: 10.1016/j.physc.2006.03.044
- [4] S. Kumar *et al.*, "Superconducting niobium coating deposited using cold spray", Mater. Lett. vol. 312 p. 131715, 2022. doi: 10.1016/j.matlet.2022.131715
- [5] Sublet *et al.*, "Thin Film Coating Optimization for HIE-ISOLDE SRF Cavities: Coating Parameters Study and Film Characterization" in Proc. SRF2013, Paris, France, Sep. 23– 27, 2013, TUP077.
- [6] Andres *et al.*, "Deposition of Niobium and Other Superconducting Materials with High Power Impulse Magnetron Sputtering: Concept and First Results", in Proc. SRF2011, Chicago, IL USA, Jul. 25–29, 2011, TUIOA06.